

Synthesis for Poly(3-hexylthiophene)-b-Polymethylmethacrylate Block Copolymer

이영민, 김진곤*, 방준하¹, Craig J. Hawker²

포항공과대학교; ¹고려대학교;

²Materials Research Laboratory, UCSB

(jkkim@postech.ac.kr*)

Poly(3-hexylthiophene) (P3HT)은 높은 전도성과 유기 용매에 대한 용해성 때문에 다양한 응용이 기대되는 전도성 고분자이다. 우리는 P3HT와 poly(methylmethacrylate) (PMMA)를 이용한 block copolymer를 합성하여 self assembly에 의한 nanostructure를 관찰하고자 한다. PMMA는 UV 노광과 acetic acid 세척으로 손쉽게 제거되기 때문에 P3HT nanostructure 응용에 유리할 것이다.